

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 09-222503

(43)Date of publication of application : 26.08.1997

(51)Int.Cl.

G02B 1/11
G02F 1/1335

(21)Application number : 08-030620

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing : 19.02.1996

(72)Inventor : YAMADA TSUKASA
NAKAMURA KAZUHIRO

(54) PRODUCTION OF ANTIREFLECTION FILM AND DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily form a layer having low refractive index and enough adhesion property between layers and to provide an excellent antireflection film which prevents reflection of external light in a display device and the like.

SOLUTION: This antireflection film is obtd. by forming a low refractive index layer on a base body or by successively forming an intermediate layer and a low refractive index layer on a base body. In this case, the low refractive index layer contains at least one kind of fluorine-contg. polymer particles having $\leq 200\text{nm}$ average particle size. This layer contains has microvoids among the fine particles formed by two or more particles stacked. Before forming the low refractive index layer, the base body or the intermediate layer to be in contact with the layer is subjected to at least one kind of surface treatment selected from among corona discharge treatment, flame treatment, UV treatment and glow discharge treatment.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-222503

(43) 公開日 平成9年(1997)8月26日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 B	1/11		G 0 2 B	1/10 A
G 0 2 F	1/1335		G 0 2 F	1/1335

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平8-30620

(22) 出願日 平成8年(1996)2月19日

(71) 出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72) 発明者 山田 司

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真
フイルム株式会社内

(72) 発明者 中村 和浩

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真
フイルム株式会社内

(54) 【発明の名称】 反射防止膜の製造方法および表示装置

(57) 【要約】

【課題】 低屈折率かつ十分な層間付着性を有する層を容易に形成し、表示装置等において、外光による反射光を防止する優れた反射防止層を提供する。

【解決手段】 支持体上に低屈折率層を設けるか、支持体の上に中間層、低屈折率層を順に設けた反射防止膜であって、低屈折率層は平均粒径が200nm以下の含フッ素重合体微粒子を少なくとも1種含む層であり、この層が少なくとも2個以上の該微粒子が積み重なることで微粒子間にミクロポイドを含有したものであって、該低屈折率層の形成前にそれが接する支持体または中間層をコロナ放電処理、火炎処理、UV処理、グロー放電処理のうちから選ばれた少なくとも1種の表面処理を施す事を特徴とする反射防止膜の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に低屈折率層を設けるか、支持体の上に中間層、低屈折率層を順に設けた反射防止膜であって、低屈折率層は平均粒径が200nm以下の含フッ素重合体微粒子を少なくとも1種含む層であり、この層が少なくとも2個以上の該微粒子が積み重なることで微粒子間にマイクロボイドを含有したものであって、該低屈折率層の形成前にそれが接する支持体または中間層をコロナ放電処理、火炎処理、UV処理、グロー放電処理のうちから選ばれた少なくとも1種の表面処理を施す事を特徴とする反射防止膜の製造方法。

【請求項2】 該表面処理を施してから10ヶ月以内に低屈折率層を形成することを特徴とする請求項1に記載の反射防止膜の製造方法。

【請求項3】 中間層が該低屈折率層よりも高い屈折率を有するものであることを特徴とする請求項1に記載の反射防止膜の製造方法。

【請求項4】 表面がアンチグレア処理されていることを特徴とする請求項1に記載の反射防止膜の製造方法。

【請求項5】 請求項1の反射防止膜を配置した表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、量産性、対汚染性に優れた、表示装置、特にLCD（液晶表示装置）等のディスプレイにおける外光の反射防止膜の層間の付着性、および耐久性改良に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、可視光のような波長域を有する光に対する反射防止膜としては、金属酸化物等の透明薄膜を積層させた多層膜が用いられてきた。単層膜では単色光に対しては有効であるもののある程度の波長域を有する光に対しては有効に反射防止できないのに対し、このような多層膜においては、積層数が多いほどに広い波長領域で有効な反射防止膜となる。そのため、従来の反射防止膜には、物理蒸着法等の手段によって金属酸化物等を3層以上積層した物が用いられてきた。しかしながら、多層構造の反射防止膜を形成するためには、予め最適に設計された各層の屈折率と膜厚との関係に従い、その膜厚を高精度に制御した物理蒸着を何回も行う必要があり、非常に高コストなものとなっていた。また、表面の耐傷性あるいは指紋付着性等の対汚染性の改善のためには例えば新たに含フッ素樹脂からなる層を設ける必要があった。

【0003】上述のような多層膜による方法の他に、空気との界面において屈折率が徐々に変化する様な膜によって有効な反射防止効果を得る方法が従来知られている。例えば、特開平2-245702号公報には、ガラス基板と MgF_2 の中間の屈折率を持つ SiO_2 超微粒子と MgF_2 超微粒子を混合してガラス基板に塗布し、

ガラス基板面から塗布膜面に向かって徐々に SiO_2 の混合比を減少させて MgF_2 の混合比を増加させる事により、塗布面とガラス基板との界面における屈折率変化が緩やかとなり、反射防止効果が得られる事が記載されている。

【0004】また、特開平5-13021号公報には、 MgF_2 、 SiO_2 等の低屈折率を有する超微粒子を用いた反射防止膜において、この超微粒子が基板上に規則正しく配列されたときに最も小さな反射率が得られることが記載されている。

【0005】また、特開平7-92305号公報には、内層がメタクリル酸メチル、メタアクリル酸、トリフルオロエチルアクリレート、N-イソブトキシメチルアクリルアミドからなり、外層がスチレン、アクリル酸、アクリル酸ブチルからなる2層構成の屈折率1.428の超微粒子が表面に露出して凹凸が形成された反射防止膜によって光線透過率が5%増加した事が記されている。

【0006】更に、特開平7-168006号公報には、テトラフルオロアクリレートと MgF_2 ゾルの混合物を塗布後、電子線照射により前記フッ素有機物成分を重合、硬化することにより得られるような、超微粒子の表面が完全に露出して凹凸状表面となっている反射防止膜によって、光線透過量が約6%向上する事が記されている。

【0007】しかしながら、前記特開平2-245702号公報に記載の反射防止膜は、混合比の異なる塗布膜を積み重ねて得られるため、膜の形成の煩雑さと屈折率のコントロールの困難さが問題であった。また、前記特開平5-13021号公報の反射防止膜においては、最表層の超微粒子がバインダで覆われているために屈折率を緩やかに変化させる事が困難な事、焼き付け温度が高温であるために用いられる基材が限定される等の問題があった。また、特開平7-92305号公報に記載の反射防止膜は、含フッ素樹脂を含む超微粒子がフッ素を含有しない樹脂成分を含むために屈折率が1.428となり、十分な反射防止効果が得られず、特開平7-168006に記載の反射防止膜は、やはり超微粒子として用いている MgF_2 自体の屈折率が1.38であるために、十分な反射防止効果が得られないという問題があった。

【0008】そこで発明者らは、平均粒径が200nm以下である含フッ素重合体からなる微粒子を含み、微粒子が少なくとも2個以上に積み重なることによって微粒子同士の間平均してマイクロボイドを含有した膜により低屈折率層の形成が可能であり、該低屈折率層を含んだ反射防止膜を形成することで優れた反射防止効果が得られることを見いだした。

【0009】しかし、単に微粒子同士を積層しただけでは粒子間の付着性が不十分であるため、膜強度が十分でなく、耐久性が劣るという欠点があった。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、マイクロボイドを含有した低屈折層を含んでなる反射防止膜において、その低屈折率層の膜強度、耐久性を改良することである。

【0011】

【課題を解決するための手段】上述の課題は下記の反射防止膜によって解決される。

(1) 支持体上に低屈折率層を設けるか、支持体の上に中間層、低屈折率層を順に設けた反射防止膜であって、低屈折率層は平均粒径が200nm以下の含フッ素重合体微粒子を少なくとも1種含む層であり、この層が少なくとも2個以上の該微粒子が積み重なることで微粒子間にマイクロボイドを含有したものであって、該低屈折率層の形成前にそれが接する支持体または中間層をコロナ放電処理、火炎処理、UV処理、グロー放電処理のうちから選ばれた少なくとも1種の表面処理を施す事を特徴とする反射防止膜の製造方法。

(2) 該表面処理を施してから10ヶ月以内に低屈折率層を形成することを特徴とする(1)に記載の反射防止膜の製造方法。

(3) 中間層が前記低屈折率層がそれよりも高い屈折率を有するものであることを特徴とする(1)に記載の反射防止膜の製造方法。

(4) 表面がアンチグレア処理されていることを特徴とする(1)に記載の反射防止膜の製造方法。

(5) (1)の反射防止膜を配置した表示装置。

【0012】

【発明の実施の形態】本発明の反射防止膜によって優れた反射防止効果が得られた事については以下のように説明できる。

【0013】図1に、含フッ素重合体微粒子を含む低屈折率層からなる反射防止膜を示す。図中で、1は微粒子層と空気が混在している層(マイクロボイド含有層)、3は基材である。マイクロボイドは1の層中にほぼ均一に分散して存在する。また、この低屈折率層は、反射防止を行うべき透明基材の最表面に設けられる。本発明においては、粒子間のボイドおよび粒子と基材との間に形成されるボイドが均一であること、およびボイドが光を散乱しない大きさであることに特徴がある。従って該低屈折率層は微視的にはマイクロボイド含有微粒子多孔質膜であるが、巨視的には均一な低屈折率層とみなすことができる。

【0014】空気の屈折率は1であり、本発明における微粒子の屈折率は空気の屈折率1よりも高い。本発明の低屈折率層の屈折率は、重合体を微粒子にすることによって、素材の屈折率よりもマイクロボイドの体積分率の分だけ低くすることができる。従って、空気層と基材3の間に位置するマイクロボイド含有層1の屈折率は、空気層の屈折率と微粒子自体の屈折率の間に位置することにな

る。

【0015】単分散の粒径を有する微粒子が最密充填された場合には、微粒子間に26%の空隙(マイクロボイド)ができ、単純立方充填の場合は48%に増える。実際には粒径にある程度の分布が存在するために、実際のマイクロボイドの含率は計算値からは若干ずれるものの、50%程度のマイクロボイド膜の形成が可能である。また、微粒子同士の凝着方法や凝着条件によっても空隙率は変化する。マイクロボイドの含有量が高すぎると、膜の機械的強度を損なってしまうため、膜強度の観点からもマイクロボイドの含有量は50%以下であることが好ましい。

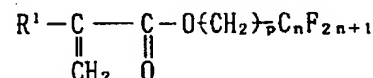
【0016】本発明において用いられる微粒子の粒径は200nm以下、5nm以上であり、膜強度向上のためには50nm以下が好ましい。このような微粒子の例として、ポリマーラテックスが挙げられる。微粒子の粒径が増大すると前方散乱が増加し、200nmを越えると散乱光に色付きが生じ、好ましくない。

【0017】微粒子を形成する重合体のモノマー単位には特に限定がなく、例えば、アクリル酸エチル、アクリル酸2-エチルヘキシルなどのアクリル酸エステル類、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチルなどのメタクリル酸エステル類のほか、スチレン誘導体、塩化ビニル重合体、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アクリロニトリル誘導体、ウレタン類などを挙げることができる。また、積層された微粒子同士の付着力を高めるためにイソシアナート基、アジリジン基、アルデヒド基、エポキシ基などの官能基を導入することが有効である。実際には、低屈折率化の実現のため含フッ素モノマーの単独重合体または共重合体、あるいは含フッ素モノマーと非フッ素モノマーとの共重合体の使用が必要となる。あるいは、粒子をコアシェル化してコア部分にはフッ素含量の多い重合体を用い、シェル部に熱架橋基を導入するかシランカップリング剤と反応可能な官能基を有する重合体とすることが有効である。

【0018】以下に含フッ素モノマーを挙げるがこれに限定されない。特に、パーフルオロ-2、2-ジメチル-3-ジオキソール或いはテトラフルオロエチレンは屈折率が非常に低いために好ましく用いられる。

【0019】

【化1】

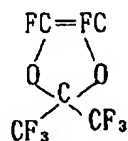
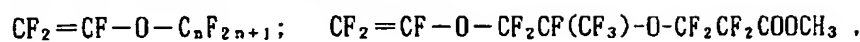
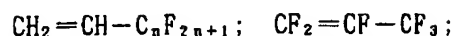
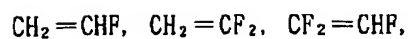


【0020】式中、 R^1 は水素原子、メチル基、またはフッ素原子を表し、 p 、 n は正の整数を表す。又、下記のモノマーを挙げることができる。

【0021】また、下記のモノマーを用いることができる。

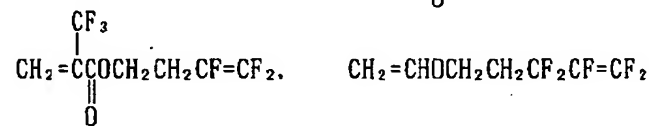
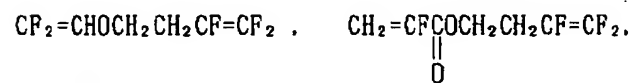
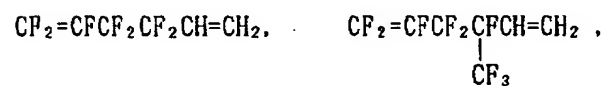
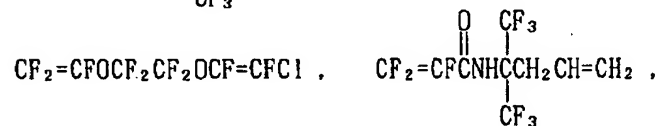
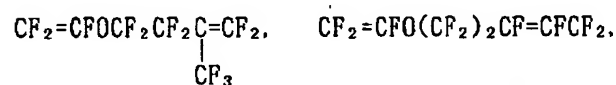
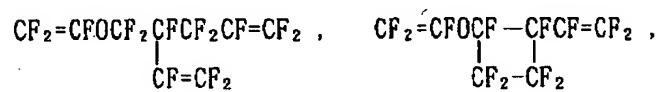
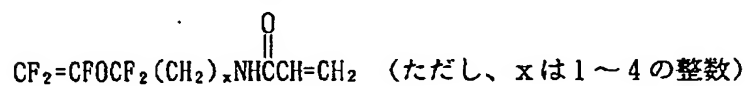
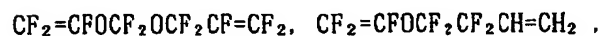
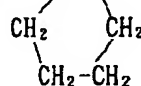
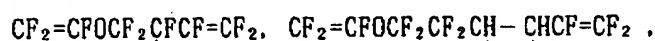
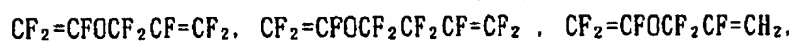
【0022】

【化2】



【0023】

【化3】

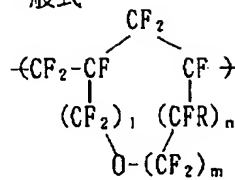


【0024】前記のモノマーを用いた含フッ素重合体としては、下記のもの挙げられる。

【0025】

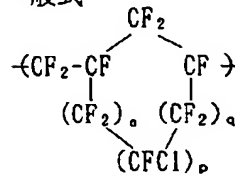
【化4】

一般式



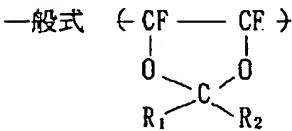
(ただし、 l は0~5、 m は0~4、 n は0~1、 $l+m+n$ は1~6、 R はF又は CF_2)、

一般式

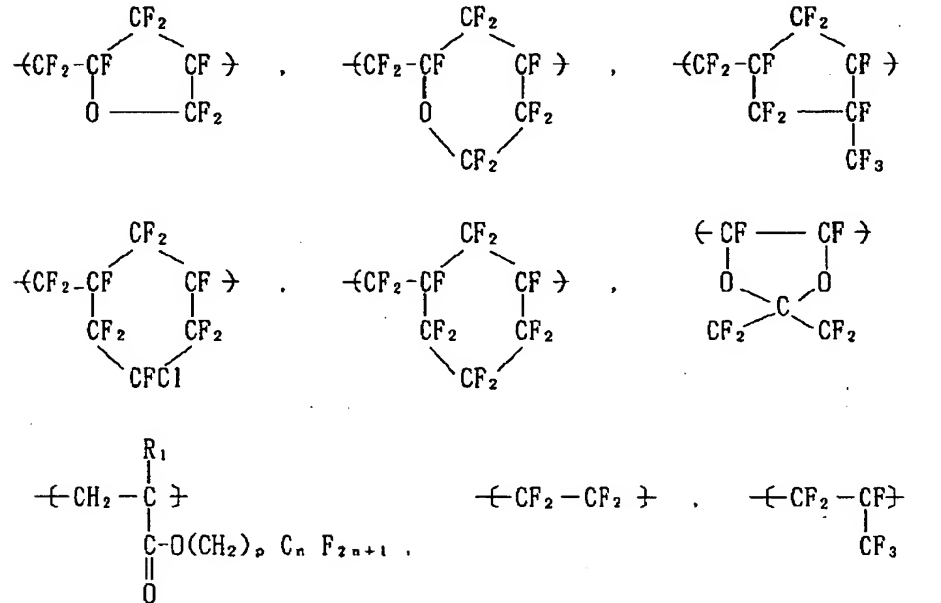


(ただし、 o 、 p 、 q は0~5、 $o+p+q$ は1~6)、

一般式



(ただし、 R_1 はFまたは CF_2 、 R_2 はF又は CF_2)



【0026】含フッ素重合体の屈折率はフッ素原子の含有量と共にほぼリニアに低下し、層としての屈折率はマイクロボイドの含有量の増加と共にさらに低下する。この両方のたし合わせとしての層の屈折率を十分に低くするためには、含フッ素重合体が0.35重量分率以上、0.75重量分率以下のフッ素原子を含み、含フッ素重合体微粒子からなる層が0.10体積分率以上、0.50体積分率以下のマイクロボイドを含むことが必要となる。

【0027】本発明における反射防止膜の重合体粒子には結晶性、非晶性のいずれのものも用いる事ができる。これまで結晶性を有する重合体粒子は光線透過率を低減させるために光学材料の膜としては用いる事ができなかったが、光の波長よりも十分に小さな粒径を有する微粒子を用いる事によって、結晶性を有するものであっても

光線透過率を低減する事無く反射防止膜として用いる事ができる。

【0028】このような低屈折率を有する微粒子層は、図1に示す単層膜だけでなく、多層膜の最上層として用いる事もできる。図2に、基材フィルム上に基材の屈折率よりも高い屈折率を有する層2を設け、さらにその上に含フッ素重合体微粒子を含む層を設けた反射防止膜を示す。このように多層化する事によってより広い波長領域において有効な反射防止膜を得る事は、従来の技術と同様な原理に基づくものである。例えば、特開昭59-50401号公報に示されているように、2層膜では、基材と接する第一層の膜の屈折率 n_1 と膜厚 d_1 および第一層と接する第二層の屈折率 n_2 と膜厚 d_2 が以下の関係を満たすようにする事によって、反射防止膜としての作用が最適化される。このような多層膜による反射防

止条件については古くから公知である。

$$\text{第1層 } m\lambda/4 \times 0.7 < n_1 d_1 < m\lambda/4 \times 1.3$$

$$\text{第2層 } n\lambda/4 \times 0.7 < n_2 d_2 < n\lambda/4 \times 1.3$$

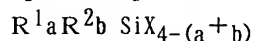
ただし、 m は正整数、 n は奇の正整数である。

【0029】本発明の反射防止膜を形成する基材としては、各種のプラスチックフィルムが使用でき、セルロース誘導体（例えば、トリアセチル（TAC）、ジアセチル、プロピオニル、ブタノイル、アセチルプロピオニルアセート、ニトロなど）、ポリアミド、ポリカーボネート、特公昭48-40414号に記載のポリエステル（特にポリエチレンテレフタレート、ポリ-1,4-シクロヘキサジメチレンテレフタレート、ポリエチレン1,2-ジフェノキシエタン-4,4'-ジカルボキシレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレートなど）、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート、ポリエーテルイミド、ポリメチルメタクリレート等のような各種透明樹脂が好ましく用いられる。

【0030】また、多層膜として用いる場合には、高屈折率層の素材として、以下のようなものが用いられる。

【0031】有機材料としては低屈折率層より屈折率の高い被膜形成性物質、たとえばポリスチレン、ポリスチレン共重合体、ポリカーボネート、ポリスチレン以外の芳香環、複素環、脂環式環状基、またはフッ素以外のハロゲン基を有する各種重合体組成物、メラミン樹脂、フェノール樹脂、ないしエポキシ樹脂などを硬化剤とする各種熱硬化性樹脂形成性組成物、脂環式ないし芳香族イソシアネートおよびまたはこれらとポリオールからなるウレタン形成性組成物、および上記の化合物に2重結合を導入することにより、ラジカル硬化を可能にした各種変性樹脂またはプレポリマを含む組成物などが好ましく用いられる。また無機系微粒子を分散させた有機材料としては一般に無機系微粒子が高屈折率を有するため有機材料単独で用いられる場合よりも低屈折率のものも用いられる。上記に述べた有機材料の他、アクリル系を含むビニル系共重合体、ポリエステル（アルキドを含む）系重合体、繊維系重合体、ウレタン系重合体、およびこれらを硬化せしめる各種の硬化剤、硬化性官能基を有する組成物など透明性があり無機系微粒子を安定に分散せしめる各種の有機材料が使用可能である。さらに有機置換されたケイ素系化合物をこれに含めることができる。

【0032】これらのケイ素系化合物は一般式



（ここで R^1 、 R^2 は各々アルキル基、アルケニル基、アリル基、またはハロゲン基、エポキシ基、アミノ基、メルカプト基、メタクリルオキシ基ないしシアノ基を有する炭化水素基。Xはアルコキシル、アルコキシアルコキシル、ハロゲンないしアシルオキシ基から選ばれた加水分解可能な置換基。a、bは各々0、1または2でか

つ $a+b$ が1または2である。）であらわされる化合物ないしはその加水分解生成物である。

【0033】これに分散される無機化合物としてはアルミニウム、チタニウム、ジルコニウム、アンチモンなどの金属元素の酸化物が好ましく用いられる。これらは微粒子状で粉末ないしは水および/またはその他の溶媒中へのコロイド状分散体として提供されるものである。これらは上記の有機材料または有機ケイ素化合物中に混合分散される。

【0034】被膜形成性で溶剤に分散し得るか、それ自身が液状である無機系材料としては各種元素のアルコキシド、有機酸の塩、配位性化合物と結合した配位化合物がありこれらの好適な例としては、チタンテトラエトキシド、チタンテトラ- i -プロポキシド、チタンテトラ- n -プロポキシド、チタンテトラ- n -ブトキシド、チタンテトラ-sec-ブトキシド、チタンテトラ-tert-ブトキシド、アルミニウムトリエトキシド、アルミニウムトリ- i -プロポキシド、アルミニウムトリブトキシド、アンチモントリエトキシド、アンチモントリブトキシド、ジルコニウムテトラエトキシド、ジルコニウムテトラ- i -プロポキシド、ジルコニウムテトラ- n -プロポキシド、ジルコニウムテトラ- n -ブトキシド、ジルコニウムテトラ-sec-ブトキシド、ジルコニウムテトラ-tert-ブトキシドなどの金属アルコレート化合物、さらにはジ-イソプロポキシチタニウムビスアセチルアセトネート、ジ-ブトキシチタニウムビスアセチルアセトネート、ジ-エトキシチタニウムビスアセチルアセトネート、ビスアセチルアセトンジルコニウム、アルミニウムアセチルアセトネート、アルミニウムジ- n -ブトキシドモノエチルアセトアセート、アルミニウムジ- i -プロポキシドモノメチルアセトアセート、トリ- n -ブトキシドジルコニウムモノエチルアセトアセートなどのキレート化合物、さらには炭酸ジルコニールアンモニウム、あるいはジルコニウムを主成分とする活性無機ポリマなどをあげることができる。上記に述べた他に、屈折率が比較的低いが上記の化合物と併用できるものとしてとくに各種のアルキルシリケート類もしくはその加水分解物、微粒子状シリカとくにコロイド状に分散したシリカゲルが用いられる。

【0035】本発明の低屈折率反射防止層は一般によく知られた方法、例えばディップコート法、エアナイフコート法、カーテンコート法、ローラーコート法、ワイヤーバーコート法、グラビアコート法、或いは米国特許第2,681,294号明細書に記載のホッパーを使用するエクストルージョンコート法等により塗布することができる。また必要に応じて、米国特許第2,761,791号、3,508,947号、2,941,898

号、及び3, 526, 528号明細書、原崎勇次著「コーティング工学」253頁(1973年朝倉書店発行)等に記載された方法により2層以上の層を同時に塗布することができる。

【0036】本発明の低屈折率反射防止層は、中間層として高屈折率層の他にハードコート層、防湿、帯電防止層等を設ける事もできる。また、それぞれの目的を同時に持たせる層としてもよい。ハードコート層を形成する素材としては、アクリル系、ウレタン系、エポキシ系のポリマーの他に、シリカ系の素材が使用できる。

【0037】本発明の低屈折率反射防止膜層の表面に有機、無機化合物によって凹凸を形成し、外光を散乱させて景色等の写り込みを防ぐアンチグレア効果を付与することもできる。また、この反射防止膜は単独であるいはアンチグレア効果を併用して液晶表示装置(LCD)、プラズマディスプレイ(PDP)、エレクトロルミネッセンスディスプレイ(ELD)、陰極管表示装置(CRT)などの画像表示装置に適用し、外光の反射を防止することで、視認性を大幅に改良することができる。

【0038】本発明の反射防止膜は先に述べた基材の上に直接設けることも、また上記中間層の上に設けることもできるが、これらの下層を表面処理しないと反射防止膜が容易に剥がれたり、脱膜したりすることがおこり好ましくない。次に本発明の表面処理について説明を加える。好ましい表面処理としてグロー放電処理、コロナ放電処理、紫外線(UV)処理、火炎処理を挙げることができる。中でも好ましいのが、グロー放電処理、コロナ放電処理である。これらの処理は、単独で行っても良く、2種以上を組み合わせても良い。以下にこれらの方法について詳細に説明する。グロー処理は、従来知られている方法、例えば特公昭35-7578号、同36-10336号、同45-22004号、同45-22005号、同45-24040号、同46-43480号、特開昭53-129262号、米国特許3,057,792号、同3,057,795号、同3,179,482号、同3,288,638号、同3,309,299号、同3,424,735号、同3,462,335号、同3,475,307号、同3,761,299号、同4,072,769号、英国特許891,469号、同997,093号、等を用いることができる。このようなグロー処理では、特に雰囲気中に水蒸気を導入した場合において最も優れた付着効果を得ることができる。また、この手法はフィルムの黄色化抑制、ブロッキング防止にも非常に有効である。水蒸気存在下でグロー処理を実施する時の水蒸気分圧は、10%以上、100%以下が好ましく、更に好ましくは40%以上、90%以下である。10%未満では充分な接着性を得ることが困難となる。水蒸気以外のガスは酸素、窒素等からなる空気である。

【0039】さらに、表面処理すべき下層を加熱した状

態で真空グロー処理を行うと、常温で処理するのに比べ短時間の処理で付着性が向上し、有効である。予熱温度は50℃以上、 T_g 以下が好ましく、60℃以上、 T_g 以下がより好ましく、70℃以上、 T_g 以下がさらに好ましい。 T_g 以上の温度で予熱すると接着が悪化する。グロー処理時の真空度は0.005~20 Torrとするのが好ましい。より好ましくは0.02~2 Torrである。また、電圧は、500~5000Vの間が好ましい。より好ましくは500~3000Vである。使用する放電周波数は従来技術に見られるように、直流から数1000MHz、好ましくは50Hz~20MHz、さらに好ましくは1KHz~1MHzである。放電処理強度は、0.01KV・A・分/ m^2 ~5KV・A・分/ m^2 が好ましく、更に好ましくは0.15KV・A・分/ m^2 ~1KV・A・分/ m^2 で所望の付着性能が得られる。このようにして、グロー処理を施した支持体は、直ちに冷却ロールを用いて温度を下げるのが好ましい。

【0040】コロナ処理は、最もよく知られている方法であり、従来公知のいずれの方法、例えば特公昭48-5043号、同47-51905号、特開昭47-28067号、同49-83767号、同51-41770号、同51-131576号等に開示された方法により達成することができる。放電周波数は50Hz~5000kHz、好ましくは5kHz~数100kHzが適当である。被処理物の処理強度に関しては、0.001KV・A・分/ m^2 ~5KV・A・分/ m^2 、好ましくは0.01KV・A・分/ m^2 ~1KV・A・分/ m^2 が適当である。電極と誘電体ロールのギャップクリアランスは0.5~2.5mm、好ましくは1.0~2.0mmが適当である。

【0041】紫外線処理は、特公昭43-2603号、特公昭43-2604号、特公昭45-3828号記載の処理方法によって行われるのが好ましい。水銀灯は石英管からなる高圧水銀灯、低圧水銀灯で、紫外線の波長が180~380nmの間であるものが好ましい。紫外線照射の方法については、365nmを主波長とする高圧水銀ランプであれば、照射光量20~10000(mJ/cm^2)がよく、より好ましくは50~2000(mJ/cm^2)である。254nmを主波長とする低圧水銀ランプの場合には、照射光量100~10000(mJ/cm^2)がよく、より好ましくは200~1500(mJ/cm^2)である。

【0042】火焰処理の方法は天然ガスでも液化プロパンガスでもかまわないが、空気との混合比が重要である。プロパンガスの場合は、プロパンガス/空気の好ましい混合比は、容積比で1/14~1/22、好ましくは1/16~1/19である。また、天然ガスの場合は、1/6~1/10、好ましくは1/7~1/9である。火焰処理は1~50Kcal/ m^2 、より好ましくは3~30Kcal/ m^2 の範囲で行うとよい。またバーナ

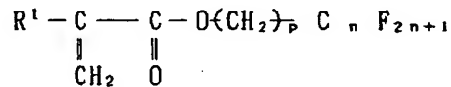
一の内炎の先端と支持体の距離を4cm未満にするとより効果的である。処理装置は春日電気(株)製フレーム処理装置を用いることができる。また、火焰処理時に支持体を支えるバックアップロールは中空型ロールで、冷却水を通して水冷し、常に一定温度で処理するのがよい。本発明において、低屈折率層の接する支持体または中間層を表面処理した後、10ヶ月以内に低屈折率層を形成することが好ましい。

表 1

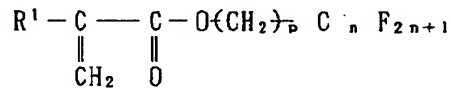
微粒子	P 1	P 2	P 3	P 4	粒径(nm)
B-1	98		2		50
B-2		95		5	49

* 重合比は重量%で記載

P 1 : 下式において、 $R^1 = H$ 、 $p = 1$ 、 $n = 1$ であるモノマー



P 2 : 下式において、 $R^1 = CH_3$ 、 $p = 1$ 、 $n = 2$ であるモノマー



P 3 : アクリル酸 2-エチルヘキシル

P 4 : メタクリル酸エチル

【0045】トリアセチルセルロース(TAC)フィルムに以下の表面処理(E-1、E-2)を施してから14日後に、上記の微粒子をブレンドして調整した微粒子混合水溶液(重量比でB-1:B-2=80:20)をバーコーターを用いて塗布した。

【0046】(E-1)コロナ放電処理

ピラー社製ソリッドステートコロナ処理機6KVAモデルを用い、30cm幅支持体の両面を室温下において20m/分で処理する。この時の電流、電圧の読み取り値から、支持体には0.375kV・A・分/m²の処理がなされている。この時の処理周波数は9.6kHz、電極と誘電体ロールのギャップクリアランスは1.6mmであった。

(E-2)グロー放電処理

【0043】

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

実施例1

乳化重合により表1に示す微粒子(B-1、B-2)を得た。

【0044】

【表1】

断面が直径2cm、長さ150cmの円柱状で冷媒流路となる中空部を持つ棒状電極を10cm間隔に4本絶縁状に固定した。この電極を真空タンク内に固定し、この電極から15cm離れ、電極面に正対するようにフィルムを走行させ、2秒間表面処理が行われるように搬送速度を制御した。フィルムが電極を通過する前に直径50cmの温度コントローラ付き加熱ロールに3/4周接触するように加熱ロールを配置し、フィルムの温度を115℃にした後グロー放電処理されるようにした。槽内の真空度は0.12Torr、雰囲気気体の水分を75%にし、放電周波数を27kHz、出力2500W、処理強度は0.5kV・A・分/m²で行った。放電処理後のフィルムは直径30cmの温度制御機付き冷却ロールに接触させ、25℃にしたあと巻き取った。なお、加熱

ロールから冷却ロールの間の張力は、5 kg/mで支持体を搬送した。

【0047】塗布物は80℃で30分乾燥し、含フッ素微粒子からなる膜厚100nmの低屈折率層を形成した。得られた膜(X-1, X-2)について屈折率、視感反射率の測定を行うとともに高温槽による60℃、95%、500時間の耐久性試験を実施した。結果を表2に示した。

【0048】比較例1

表面処理を施していないトリアセチルセルロース(TAC)フィルム上に実施例1で用いたのと同じ微粒子混合液をバーコーターを用いて塗布した。80℃で30分乾燥し、含フッ素微粒子からなる膜厚100nmの低屈折

率層を形成した。得られた膜(X-3)について実施例1と同様の試験を行った。結果を表2に示した。

【0049】比較例2

トリアセチルセルロース(TAC)フィルムにグロー放電処理を施してから12ヶ月に実施例1で用いたのと同じ微粒子混合液をバーコーターを用いて塗布した。80℃で30分乾燥し、含フッ素微粒子からなる膜厚100nmの低屈折率層を形成した。得られた膜(X-4)について実施例1と同様の試験を行った。結果を表2に示した。

【0050】

【表2】

表2

実験番号	屈折率	視感反射率	耐久試験	備考
X-1	1.29	0.6%	○	実施例1
X-2	1.30	0.7%	○	実施例1
X-3	1.29	0.7%	×	比較例1
X-4	1.29	0.7%	△	比較例2

【0051】表から明らかなように、実施例1の2例では耐久性試験でも泡の発生や剥がれが起こらず比較例2に比べて耐久性が大幅に改良されていることがわかる。比較例2では比較例1に比べると耐久性の向上が認められるものの実施例1に比べると不十分な性能であることがわかる。

【0052】実施例2

TACフィルムに3重量%のポリスチレン(商品名:トーポレックスGPPS525-51(三井東圧製))を含むトルエン溶液をスピンコータを用いて塗布し、屈折率1.585、膜厚160nmの高屈折率層を形成した。

表3

実験番号	屈折率	視感反射率	膜強度	備考
X-5	1.29	0.2%	○	実施例2
X-6	1.29	0.2%	×	比較例3

【0055】本実施例から明らかなように、本発明の反射防止膜は従来より用いられてきた多層蒸着型の反射防止膜と同等の性能を有するだけでなく十分な耐久性を有していることがわかる。

【0056】

【発明の効果】本発明の表面処理によって、通常表面エネルギーが低く、多層との付着性が十分でない含フッ素素材との付着性を改善することができ、高温での耐久試験においても割れ、剥がれ等の発生しない反射防止膜を提供することができる。

実施例1と同じグロー放電処理を行ってから14日後に、実施例1と同じ微粒子分散液を塗布、乾燥し、得られた膜(X-5)について実施例1と同じ評価を行った。結果を表3に示した。

【0053】比較例2

実施例2で用いたのと同じ高屈折率層を形成したTACを表面処理せずに、実施例1と同じ微粒子分散液を塗布、乾燥し、得られた膜(X-6)について実施例1と同じ評価を行った。結果を表3に示した。

【0054】

【表3】

【図面の簡単な説明】

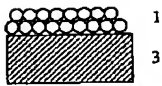
【図1】本発明の含フッ素重合体微粒子から成る層による反射防止膜の断面図を示す。

【図2】本発明の含フッ素重合体微粒子から成る層と、基材よりも高い屈折率を有する層から成る反射防止膜の断面図を示す。

【符号の説明】

- 1: 含フッ素重合体微粒子層
- 2: 高屈折率層
- 3: 基材

【図 1】



【図 2】

